

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-273601

(43)Date of publication of application : 30.09.1994

(51)Int.Cl.

G02B 1/10
C23C 14/06

(21)Application number : 05-084092

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing : 18.03.1993

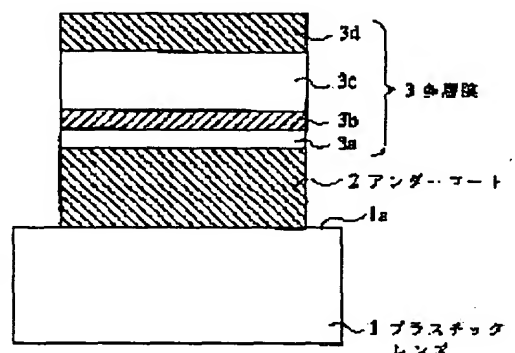
(72)Inventor : TERADA JUNJI
KAMEYAMA MAKOTO
SAKAMOTO JUNICHI

(54) ANTIREFLECTION FILM OF OPTICAL PARTS MADE OF SYNTHETIC RESIN

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the durability of the antireflection films of optical parts made of a synthetic resin.

CONSTITUTION: An under coat 2 essentially consisting of a silicon dioxide SiO_x ($2 > x > 1$) and having 200 to 300nm film thickness is formed on the surface 1a of a plastic lens 1 and multilayered films 3 are laminated on this under coat 2. These multilayered films 3 consist of thin films 3a, 3c of a first layer and third layer formed out of high-refractive index materials essentially consisting of TiO_2 or ZrO_2 or a mixture composed thereof and thin films 3b, 3d of a second layer and fourth layer 4 made of low-refractive index materials essentially consisting of the silicon dioxide SiO_x ($2 \geq x \geq 1$). The under coat 2 enhances the adhesion property between the multilayered films 3 and the surface 1a of the plastic lens 1 without impairing the antireflection characteristics of the multilayered films 3 and improves the durability, such as wear resistance and chemical resistance, thereof.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 16.09.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number] 3221764

[Date of registration] 17.08.2001

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 特 許 公 報 (B 2)

(11) 特許番号

特許第3221764号
(P3221764)

(45) 発行日 平成13年10月22日 (2001. 10. 22)

(24) 登録日 平成13年 8 月17日 (2001. 8. 17)

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

F I

G 0 2 B 1/11

C 2 3 C 14/06

P

C 2 3 C 14/06

G 0 2 B 1/10

A

請求項の数 2 (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平5-84092

(22) 出願日 平成 5 年 3 月18日 (1993. 3. 18)

(65) 公開番号 特開平6-273601

(43) 公開日 平成 6 年 9 月30日 (1994. 9. 30)

審査請求日 平成11年 9 月16日 (1999. 9. 16)

(73) 特許権者 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号

(72) 発明者 寺田 順司

東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キ
ヤノン株式会社内

(72) 発明者 亀山 誠

東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キ
ヤノン株式会社内

(72) 発明者 坂本 淳一

東京都大田区下丸子 3 丁目30番 2 号 キ
ヤノン株式会社内

(74) 代理人 100095991

弁理士 阪本 善朗

審査官 横井 康真

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 合成樹脂製光学部品の反射防止膜

1

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 合成樹脂製光学部品の表面に成膜されたケイ素酸化物 SiO_x ($2 > x > 1$) を主成分とする膜厚 200 nm ないし 300 nm のアンダーコートと、該アンダーコート上に成膜された反射防止特性を有する繰返し多層膜からなり、前記アンダーコートの屈折率が 1.49 ないし 1.59 の範囲にあり、かつ、前記繰返し多層膜が前記合成樹脂製光学部品の表面に近い側から

$$1.95 \leq n_1 \leq 2.15, 0.05 \lambda \leq n_1 d_1 \leq 0.13 \lambda,$$

$$1.43 \leq n_2 \leq 1.55, 0.103 \lambda \leq n_2 d_2 \leq 0.07 \lambda,$$

$$1.95 \leq n_3 \leq 2.15, 0.21 \lambda \leq n_3 d_3 \leq 0.49 \lambda,$$

$$1.43 \leq n_4 \leq 1.55, 0.20 \lambda \leq n_4 d_4 \leq 0.28 \lambda,$$

を満足することを特徴とする合成樹脂製光学部品の反射防止膜。

【請求項 2】 繰返し多層膜の第 1 層と第 3 層が TiO

2

順に第 1 層ないし第 4 層の 4 層の薄膜からなり、設計波長 $\lambda = 500 \text{ nm}$ 、前記第 1 層の薄膜の屈折率と光学膜厚をそれぞれ n_1 、 $n_1 d_1$ 、前記第 2 層の薄膜の屈折率と光学膜厚をそれぞれ n_2 、 $n_2 d_2$ 、前記第 3 層の薄膜の屈折率と光学膜厚をそれぞれ n_3 、 $n_3 d_3$ 、前記第 4 層の薄膜の屈折率と光学膜厚をそれぞれ n_4 、 $n_4 d_4$ としたときに、これらの薄膜の屈折率と光学膜厚が以下の条件式、

2 または ZrO_2 またはこれらの混合物を主成分とする高屈折率材料から形成され、第 2 層と第 4 層が SiO_x ($2 \geq x \geq 1$) を主成分とする低屈折率材料から形成さ

れたことを特徴とする請求項1記載の合成樹脂製光学部品の反射防止膜。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、プラスチックレンズ等の合成樹脂製光学部品の表面反射を防止するための合成樹脂製光学部品の反射防止膜に関するものである。

【0002】

【従来の技術】従来から、光学レンズ等の光学部品の表面反射を防止するために、ケイ素酸化物 SiO_x の薄膜を設けたり、あるいは ZrO_2 、 TiO_2 、 CaO_2 、 Ta_2O_5 等の高屈折率材料の薄膜と MgF_2 、 SiO_2 等の低屈折率材料の薄膜を交互に蒸着した多層膜からなる反射防止膜を設ける方法が提案されており、特に、プラスチックレンズ等の合成樹脂製の光学部品においては、その表面の軟質性や耐薬品性等を補うことも必要であるため、硬度が高く、耐薬品性等にすぐれたケイ素酸化物 SiO_x の薄膜を反射防止膜の第1層あるいは中間層として用いることが多い。

【0003】一例として、特開昭60-98401号公報には、アクリルレンズの表面に SiO からなる屈折率 n が1.55以上で厚さ89nm以下の四分の一波長膜（以下、「 $\lambda/4$ 膜」という。）を蒸着し、その上に MgF_2 からなる屈折率 $n=1.38$ の $\lambda/4$ 膜を積層した2層膜の反射防止膜が提案されており、また、特開昭60-225101号公報には、第1層として SiO_2 からなる屈折率 $n=1.47$ 、膜厚 $d=354\text{nm}$ 、光学膜厚 $nd=\lambda_0$ の薄膜を真空蒸着によって形成し、その上に順次、 Ta_2O_5 からなる屈折率 $n=2.05$ 、光学膜厚 $nd=0.057\lambda_0$ の薄膜と、 SiO_2 からなる屈折率 $n=1.47$ 、光学膜厚 $d=0.11\lambda_0$ の薄膜と、 Ta_2O_5 からなる屈折率 $n=2.05$ 、光学膜厚 $nd=0.538\lambda_0$ の薄膜と、 SiO_2 からなる屈折率 $n=1.47$ 、光学膜厚 $nd=0.258\lambda_0$ の薄膜を積層した5層膜からなる反射防止膜が提案されており（設計波長 $\lambda_0=520\text{nm}$ ）、さらに、特開平3-116101号公報には、メタクリル樹脂注型基板上に第1層として SiO_x からなる屈折率 $n=1.60$ 、光学膜厚 $nd=(\lambda_0/4)\times 20\%$ （ $d=17\sim 18\text{nm}$ ）の薄膜を真空蒸着によって形成し、その上に、 TiO_2 からなる屈折率 $n=1.95$ 、光学膜厚 $nd=(\lambda_0/4)\times 20\%$ の薄膜と、 SiO_2 からなる屈折率 $n=1.45$ 、光学膜厚 $nd=(\lambda_0/4)\times 40\%$ の薄膜と、 TiO_2 からなる屈折率 $n=2.0$ 、光学膜厚 $nd=(\lambda_0/4)\times 70\%$ の薄膜と、 SiO_2 から

なる屈折率 $n=1.45$ 、光学膜厚 $nd=(\lambda_0/4)\times 95\%$ の薄膜を積層した5層膜からなる反射防止膜（設計波長 $\lambda_0=550\sim 570\text{nm}$ ）が提案されている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記従来の技術によれば、いずれも居住用空間等の限られた環境で用いる場合は著しく性能が劣化するおそれはないが、屋外等において厳しい温度条件に曝されたり、温度や湿度の変化の大きい環境で長期にわたって使用されると、耐摩耗性や耐薬品性が劣化したり、合成樹脂の母材の熱歪等によって反射防止膜にクラック（膜割れ）が発生し、ひどい時には膜剥離を起すおそれがある。

【0005】また、後述する品質評価テストの結果、前述の特開昭60-98401号公報および特開平3-116101号公報に記載された反射防止膜は、成膜直後からその耐摩耗性や耐薬品性が不充分であることが判明し、特開昭60-225101号公報に記載された反射防止膜は、可視域の光に対して3%程度の吸収性を有し、その光学特性に難点があることが判明した。

【0006】本発明は上記従来の技術の未解決の課題に鑑みてなされたものであり、耐摩耗性や耐薬品性および光学特性にすぐれており、かつ、厳しい温度条件や湿度条件、あるいは、温度や湿度が大きく変化する環境で長時間使用しても、前述の特性が劣化したり、クラックや膜剥離を起すおそれのない合成樹脂製光学部品の反射防止膜を提供することを目的とするものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために本発明の反射防止膜は、合成樹脂製光学部品の表面に成膜されたケイ素酸化物 SiO_x （ $2 > x > 1$ ）を主成分とする膜厚200nmないし300nmのアンダーコートと、該アンダーコート上に成膜された反射防止特性を有する繰返し多層膜からなり、前記アンダーコートの屈折率が1.49ないし1.59の範囲にあり、かつ、前記繰返し多層膜が前記合成樹脂製光学部品の表面に近い側から順に第1層ないし第4層の4層の薄膜からなり、設計波長 $\lambda=500\text{nm}$ 、前記第1層の薄膜の屈折率と光学膜厚をそれぞれ n_1 、 n_1d_1 、前記第2層の薄膜の屈折率と光学膜厚をそれぞれ n_2 、 n_2d_2 、前記第3層の薄膜の屈折率と光学膜厚をそれぞれ n_3 、 n_3d_3 、前記第4層の薄膜の屈折率と光学膜厚をそれぞれ n_4 、 n_4d_4 としたときに、これらの薄膜の屈折率と光学膜厚が以下の条件式、

$$\begin{aligned} 1.95 \leq n_1 \leq 2.15, & 0.05\lambda \leq n_1d_1 \leq 0.13\lambda, \\ 1.43 \leq n_2 \leq 1.55, & 0.03\lambda \leq n_2d_2 \leq 0.07\lambda, \\ 1.95 \leq n_3 \leq 2.15, & 0.21\lambda \leq n_3d_3 \leq 0.49\lambda, \\ 1.43 \leq n_4 \leq 1.55, & 0.20\lambda \leq n_4d_4 \leq 0.28\lambda, \end{aligned}$$

を満足することを特徴とする。

【0008】また、繰返し多層膜の第1層と第3層がT

i O₂ または Zr O₂ またはこれらの混合物を主成分とする高屈折率材料から形成され、第2層と第4層が S i O_x (2 ≧ x ≧ 1) を主成分とする低屈折率材料から形成されるとよい。

【0009】

【作用】上記装置によれば、硬度が高く、耐薬品性や合成樹脂に対する密着性にすぐれたケイ素酸化物 S i O_x (2 > x > 1) を主成分とする薄膜を、反射防止特性に関与しないアンダーコートとして用いることによって、反射防止膜の耐摩耗性や耐薬品性および合成樹脂に対する密着性を向上させる。アンダーコートの膜厚を200 nm以上にするこ

【0010】

【実施例】本発明の実施例を図面に基づいて説明する。

【0011】図1は一実施例を示す模式断面図であつて、本実施例の合成樹脂製光学部品の反射防止膜E1は、ポリメタクリル酸メチル (PMMA) で作られたプラスチックレンズ1の表面1aに蒸着されたアンダーコート2と、これに積層された繰返し多層膜である多層膜3からなり、アンダーコート2は前述の合成樹脂製材料に対して良好な密着性を有し、かつ、耐薬品性、および耐摩耗性にすぐれたケイ素酸化物 S i O_x (2 > x > 1) を主成分とする屈折率 n = 1.49 ~ 1.59 の低屈折率材料からなる膜厚 d = 200 nm ~ 300 nm の薄膜であり、多層膜3は、酸化チタン T i O₂ または酸化ジルコニウム Z r O₂ またはこれらの混合物を主成分とする高屈折率材料からなる第1層の薄膜 (以下、「第

1層」という。) 3aと、ケイ素酸化物 S i O_x (2 ≧ x ≧ 1) を主成分とする低屈折率材料からなる第2層の薄膜 (以下、「第2層」という。) 3bと、酸化チタン T i O₂ または酸化ジルコニウム Z r O₂ またはこれらの混合物を主成分とする高屈折率材料からなる第3層の薄膜 (以下、「第3層」という。) 3cと、ケイ素酸化物 S i O_x (2 ≧ x ≧ 1) を主成分とする低屈折率材料からなる第4層の薄膜 (以下、「第4層」という。) 3dによって構成されている。

【0012】アンダーコート2の材料として屈折率 n = 1.49 ~ 1.59 のケイ素酸化物を主成分とする低屈折率材料を選んだ理由は、合成樹脂製光学部品の材料として多用されるポリメタクリル酸メチル (PMMA) やポリカーボネート (PC) やポリスチレン (PS) の屈折率が上記の範囲にあること、および、上記低屈折率材料が、耐薬品性や耐摩耗性にすぐれており、上記の合成樹脂に対して良好な密着性を有し、かつ、アンダーコートとして用いた場合に光散乱量および光吸収量が少いためである。

【0013】また、アンダーコート2の膜厚が200 nm以下であると、十分な耐薬品性や耐摩耗性を得ることができず、300 nm以上である場合は逆にクラックが発生しやすいことが実験によって判明している。なお、多層膜3の第1層3aと第2層3bは高屈折率材料と低屈折率材料からなる等価薄膜を構成し、多層膜3の基本的な膜構成は、設計波長 λ に対して前記等価薄膜の膜厚が λ / 4、第3層3cの膜厚が λ / 4 または λ / 2、第4層3dの膜厚が λ / 4 である。また、多層膜3の各層3a ~ 3dの屈折率 n および光学膜厚 n d は以下の範囲であるのが望ましい。

【0014】

	屈折率 n	光学膜厚 n d
第1層3a	1.95 ~ 2.15	0.05 λ ~ 0.13 λ
第2層3b	1.43 ~ 1.55	0.03 λ ~ 0.07 λ
第3層3c	1.95 ~ 2.15	0.21 λ ~ 0.49 λ
第4層3d	1.43 ~ 1.55	0.20 λ ~ 0.28 λ

ここで、基本波長 λ = 500 nm

次に、本実施例の製造工程を説明する。

【0015】まず、ポリメタクリル酸メチル (PMMA) のプラスチックレンズ1を公知の真空蒸着室に搬入し、該真空蒸着室を排気して 3 × 10⁻⁵ t o r r 以上の高真空としたうえで、O₂ ガスを導入し、真空蒸着室の圧力を 1.0 × 10⁻⁴ t o r r に設定する。次に抵抗加熱法あるいは電子ビーム加熱法によってケイ素酸化物 S i O_x (2 > x > 1) を主成分とする蒸発材料を加熱蒸発させ、プラスチックレンズ1の表面1aに光学膜厚 n d = 330 nm のアンダーコート2を形成する。このときの蒸着速度 10 Å / s e c であった。次いで、O₂ ガス導入量を制御して真空蒸着室の圧力を 5 × 10⁻⁵ t o

r r に設定し、Zr O₂ と T i O₂ の混合物を主成分とする蒸発材料を電子ビーム加熱法によって加熱蒸発させ、蒸着速度 5 Å / s e c で光学膜厚 n d = 36 nm の多層膜3の第1層3aを形成する。さらに、O₂ ガス導入量を制御して真空蒸着室の圧力を 1.0 × 10⁻⁴ t o r r に設定し、S i O₂ を主成分とする蒸発材料を電子ビーム加熱法によって加熱蒸発させ、蒸着速度 10 Å / s e c で光学膜厚 n d = 24 nm の第2層3bを形成し、次いで、O₂ ガス導入量を制御して真空蒸着室の圧力を 5 × 10⁻⁵ t o r r に設定し、Zr O₂ と T i O₂ の混合物を主成分とする蒸発材料を電子ビーム加熱法によって加熱蒸発させ、蒸着速度 5 Å / s e c で光学膜厚 n d = 210 nm の第3層3cを形成し、さらに、O₂

ガス導入量を制御して真空蒸着室の圧力を 1.0×10^{-4} torrに設定し、 SiO_2 を主成分とする蒸発材料を電子ビーム加熱法によって加熱蒸発させ、蒸着速度 10 \AA/sec で光学膜厚 $nd=115 \text{ nm}$ の第4層3dを形成したのち、 O_2 ガスの導入を停止して真空蒸着室の圧力を一旦 3×10^{-5} torr以上の高真空中に減圧したうえで大気圧まで昇圧し、真空蒸着室を開放して製品

を取出す。

【0016】このようにして製作された反射防止膜E1の材料構成、各薄膜の屈折率 n 、膜厚 d および光学膜厚 nd を表1に示し、また、その反射防止特性を図2に示す。

【0017】

【表1】

構成	材料	屈折率 n at 587nm	光学膜厚 nd (d)	
			nm(nm)	$\lambda=460\text{nm}$
多層膜の第4層	SiO_2	1.47	115	0.25λ
多層膜の第3層	SiO_2 と TiO_2 の混合材	2.01	210	0.45λ
多層膜の第2層	SiO_2	1.47	22	0.04λ
多層膜の第1層	SiO_2 と TiO_2 の混合材	2.01	36	0.07λ
アンダーコート	SiO_2 ($2 > x > 1$)	1.55	330(208)	0.71λ
プラスチックレンズ	PMMA	1.49	—	—

次に、上記の製造工程の一部および反射防止膜またはプラスチックレンズの材料の一部を変更して第1ないし第3の変形例の反射防止膜E2～E4を製作した。第1変形例の反射防止膜E2の製造工程においては、アンダーコート

30

を蒸着する際の真空蒸着室の O_2 ガス雰囲気圧力を 1.5×10^{-4} torrとし、多層膜の第2層と第4層は SiO_x ($2 \geq x \geq 1$)を主成分とした低屈折率材料を公知の抵抗加熱法または電子ビーム加熱法で加熱蒸発させ、真空蒸着室の O_2 ガス雰囲気圧力をアンダーコート

40

を蒸着するときと同じ 1.5×10^{-4} torrに設定し、また多層膜の第1層と第3層は TiO_2 を主成分とする高屈折率材料を公知の抵抗加熱法または電子ビーム加熱法で加熱蒸発させた。他の点は本実施例の反射防止膜E1の製造工程と同様であるので説明は省略する。

【0018】第2変形例の反射防止膜E3の製造工程に

【0019】第3変形例の反射防止膜E4は、プラスチックレンズの材料にポリカーボネート(PC)を用いて製作した。製造工程は本実施例の反射防止膜E1と同様である。

【0020】このようにして製作された第1ないし第3の変形例の反射防止膜E2～E4の材料構成、各薄膜の屈折率 n 、膜厚 d および光学膜厚 nd をそれぞれ表2ないし表4に示し、また、その反射防止特性をそれぞれ図3ないし図5に示す。

【0021】

【表2】

構成	材料	屈折率n at 587nm	光学膜厚nd (d) nm (nm) $\lambda=460\text{nm}$	
多層膜の第4層	SiO_2 ($2 \geq x \geq 1$)	1.50	115	0.25λ
多層膜の第3層	TiO_2	2.10	220	0.47λ
多層膜の第2層	SiO_2 ($2 \geq x \geq 1$)	1.50	24	0.05λ
多層膜の第1層	TiO_2	2.10	36	0.07λ
アンダーコート	SiO_2 ($2 > x > 1$)	1.50	375(250)	0.81λ
プラスチックレンズ	PMMA	1.49	—	—

【0022】

【表3】

構成	材料	屈折率n at 587nm	光学膜厚nd (d) nm (nm) $\lambda=460\text{nm}$	
多層膜の第4層	SiO_2	1.44	115	0.25λ
多層膜の第3層	SiO_2 と TiO_2 の混合材	2.14	206	0.44λ
多層膜の第2層	SiO_2	1.44	27	0.05
多層膜の第1層	SiO_2 と TiO_2 の混合材	2.14	28	0.06λ
アンダーコート	SiO_2 ($2 > x > 1$)	1.53	330(215)	0.71λ
プラスチックレンズ	PMMA	1.49	—	—

【0023】

【表4】

構成	材料	屈折率n at 587nm	光学膜厚nd (d)	
			nm(nm)	$\lambda=490\text{nm}$
多層膜の第4層	SiO_2	1.47	122	0.25 λ
多層膜の第3層	SiO_2 と TiO_2 の混合材	2.01	205	0.41 λ
多層膜の第2層	SiO_2	1.47	20	0.04 λ
多層膜の第1層	SiO_2 と TiO_2 の混合材	2.01	40	0.08 λ
アンダーコート	SiO_2 ($2 > x > 1$)	1.55	462(298)	0.94 λ
プラスチックレンズ	PC	1.59	—	—

また、比較のために、アンダーコートの膜厚dを180nmとして本実施例の反射防止膜E1と同じ製造工程によって第1比較例の反射防止膜E5を製作し、さらに、アンダーコートの膜厚dを310nmとして反射防止膜E1と同じ製造工程によって第2の比較例の反射防止膜

E6を製作した。両者の材料構成、各薄膜の屈折率n、膜厚dおよび光学膜厚ndをそれぞれ表5、6に示し、また反射防止特性をそれぞれ図6、7に示す。

【0024】

【表5】

構成	材料	屈折率n at 587nm	光学膜厚nd (d)	
			nm(nm)	$\lambda=480\text{nm}$
多層膜の第4層	SiO_2	1.47	120	0.25 λ
多層膜の第3層	SiO_2 と TiO_2 の混合材	2.01	227	0.47 λ
多層膜の第2層	SiO_2	1.47	31	0.06 λ
多層膜の第1層	SiO_2 と TiO_2 の混合材	2.01	31	0.06 λ
アンダーコート	SiO_2 ($2 > x > 1$)	1.55	279(180)	0.58 λ
プラスチックレンズ	PMMA	1.49	—	—

【0025】

【表6】

構成	材料	屈折率n at 587nm	光学膜厚nd (d) nm(nm) $\lambda=490nm$	
多層膜の第4層	SiO ₂	1.47	122	0.25 λ
多層膜の第3層	SiO ₂ とTiO ₂ の混合材	2.01	242	0.49 λ
多層膜の第2層	SiO ₂	1.47	34	0.07 λ
多層膜の第1層	SiO ₂ とTiO ₂ の混合材	2.01	29	0.06 λ
アンダーコート	SiO ₂ (2>x>1)	1.55	480(310)	0.63 λ
プラスチックレンズ	PMMA	1.49	—	—

次に、各反射防止膜E1～E6および前述の特開昭60-98401号公報の反射防止膜を従来例1、特開昭60-25101号公報の反射防止膜を従来例2、特開平3-16101号公報の反射防止膜を従来例3として、

20 それぞれの品質を評価する品質評価テストを行った結果を表7に示す。

【0026】

【表7】

膜名	アンダーコート		高屈折率材料	低屈折率材料	層数	光学特性	初期特性				耐環境性						基 材
											高温高湿試験			熱衝撃試験			
	膜材	膜厚 d nm					外 観	密着性	耐摩耗性	耐薬品性	外 観	密着性	耐摩耗性	耐薬品性			
E1	SiO _x	208	ZrO ₂ + TiO ₂	SiO ₂	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PMMA	
E2	SiO _x	250	TiO ₂	SiO _x	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PMMA	
E3	SiO _x	215	ZrO ₂ + TiO ₂	SiO ₂	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PMMA	
E4	SiO _x	298	ZrO ₂ + TiO ₂	SiO ₂	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	PC	
E5	SiO _x	180	ZrO ₂ + TiO ₂	SiO ₂	5	○	○	○	△	○	△	○	○	○	△	PMMA	
E6	SiO _x	310	ZrO ₂ + TiO ₂	SiO ₂	5	○	○	○	○	△	△	○	○	△	△	PMMA	
従来例1	SiO	89	-	MgF ₂	2	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	PMMA	
従来例2	SiO ₂	354	Ta ₂ O ₅	SiO ₂	5	△	○	○	○	△	△	○	○	△	△	PMMA	
従来例3	SiO _x	18	TiO ₂	SiO ₂	5	○	○	○	×	○	×	○	○	○	×	PMMA	
○ 良好 △ 一部不良 × 不良																	

○ 良好 △ 一部不良 × 不良

表7から、本実施例の反射防止膜E1およびその変形例の反射防止膜E2～E4はいずれも密着性、耐摩耗性および耐薬品性においてすぐれており、また、これらの特性は、高温高湿の厳しい環境においてもあるいは厳しい温度変化のある環境においても大きく損なわれるおそれがないことが判る。なお、第1比較例の反射防止膜E5はアンダーコートの膜厚が不足したために耐薬品性が不

【0027】表7における(1)密着性、(2)耐摩耗性、(3)耐薬品性、(4)耐環境性は以下のテスト方法で評価した。

【0028】(1)密着性

反射防止膜の表面に、セロファンテープを貼り、膜面に対し垂直方向にテープを瞬時に引剥し、目視にて膜剥離の有無を観察する。膜剥離が起きていない場合のみを良好とした。

【0029】(2)耐摩耗性

反射防止膜の表面に、シルボン紙を当て荷重300gにて、往復50回こすり、目視にて傷の有無を観察する。膜傷が発生していない場合のみを良好とした。

【0030】(3) 耐薬品性

反射防止膜の表面に、エチルエーテルを浸したシルボン紙を当て荷重300gにて、往復50回こすり、目視にて膜浮きや膜傷等の有無を観察する。膜浮きや膜傷等が発生していない場合のみを良好とした。

【0031】(4) 耐環境性

(4-1) 高温高湿加速試験

反射防止膜を形成したプラスチックレンズを70℃-85%RHに設定された恒温槽内に500時間放置した後、目視にて膜外観を観察し、異常が認められない場合のみを良好とした。さらに、前記の(1)密着性、(2)耐摩耗性、(3)耐薬品性の評価テストを実施した。

【0032】(4-2) 熱衝撃試験

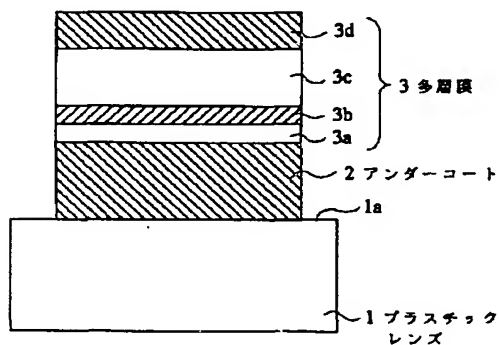
反射防止膜を形成したプラスチックレンズを-30℃/60℃-60%RHに各2時間のサイクルを10サイクル実施した後、目視にて膜外観を観察し、異常が認められない場合のみを良好とした。さらに、前記の(1)密着性、(2)耐摩耗性、(3)耐薬品性の評価テストを実施した。

【0033】

【発明の効果】本発明は、上述のとおり構成されているので、以下に記載するような効果を奏する。

【0034】耐摩耗性や耐薬品性および光学特性にすぐれており、かつ、屋外等の厳しい温度条件や湿度条件、あるいは温度や湿度が大きく変化する環境で長時間使用

【図1】



しても、前述の特性が劣化したり、クラックや膜剥離を起すおそれのない合成樹脂製光学部品の反射防止膜を実現する。その結果、屋外等ですぐれた耐久性を示す反射の少ない合成樹脂製光学部品を実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】一実施例を示す模式断面図である。

【図2】図1の反射防止膜の反射防止特性を示すグラフである。

【図3】第1変形例の反射防止膜の反射防止特性を示すグラフである。

【図4】第2変形例の反射防止膜の反射防止特性を示すグラフである。

【図5】第3変形例の反射防止膜の反射防止特性を示すグラフである。

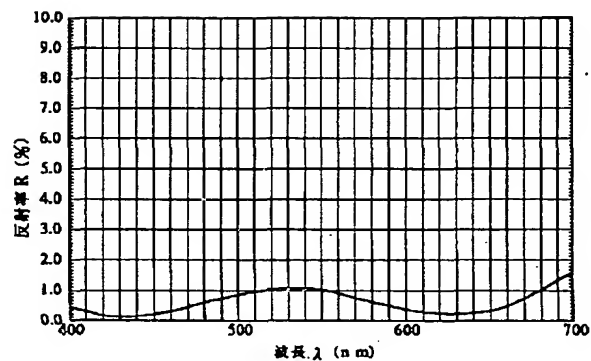
【図6】第1比較例の反射防止膜の反射防止特性を示すグラフである。

【図7】第2比較例の反射防止膜の反射防止特性を示すグラフである。

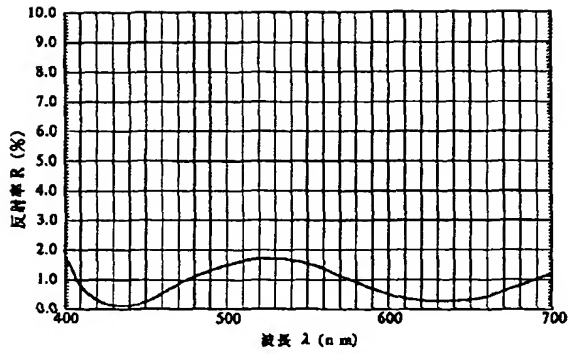
【符号の説明】

- 1 プラスチックレンズ
- 2 アンダーコート
- 3 多層膜
- 3a 第1層
- 3b 第2層
- 3c 第3層
- 3d 第4層

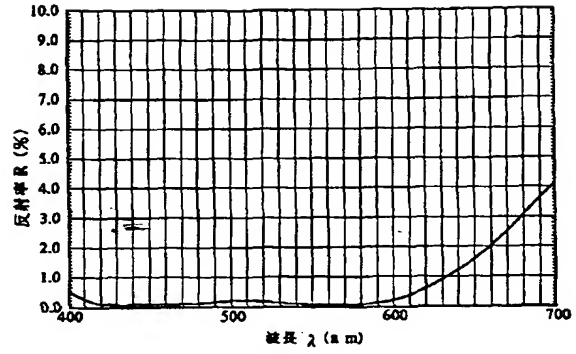
【図2】



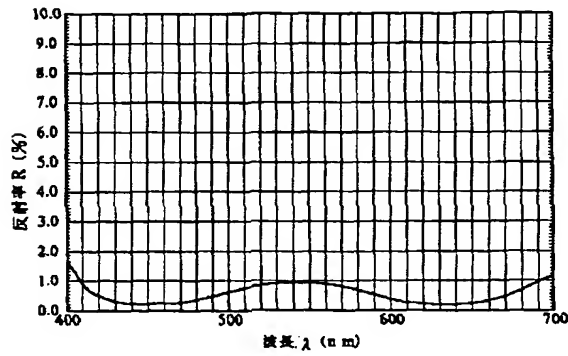
【図3】



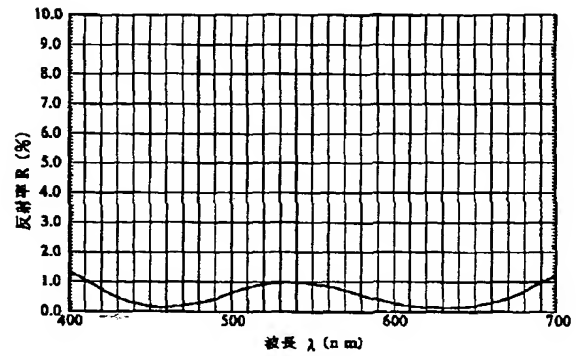
【図4】



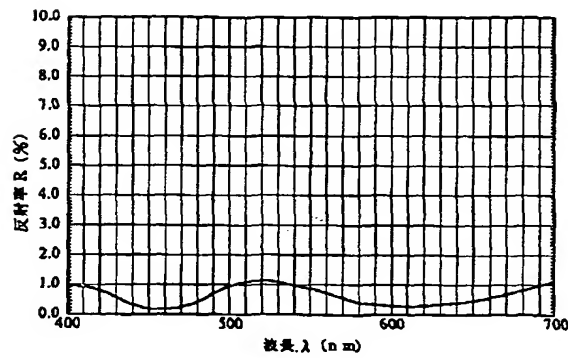
【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの続き

(56) 参考文献 特開 昭63-217302 (J P, A)

(58) 調査した分野(Int.Cl.⁷, D B 名)

G02B 1/10 - 1/12